



CONVOCATORIA CURSO EN LINEA

USO DE LA TECNOLOGÍA SIG EN EL CATASTRO, EDICIÓN #5

<p>Inscríbete</p> <p>Hasta el 8 de Sept., 2011</p>  <p>Haga clic aquí</p>	<p>Clases</p> <p>3 Octubre - 25 Noviembre</p> 	<p>Duración</p> <p>8 Semanas (135 h.)</p> 	<p>Idioma</p> <p>Español</p> 	<p>Costo Final</p> <p>US\$ 150 después de beca OEA</p> 
---	--	--	---	---



Si usted es seleccionado al curso, automáticamente será beneficiario de una beca parcial que le entrega la OEA por US\$200 sobre el valor total del Curso de US\$350.

Sobre el curso

Una adecuada modernización ofrecerá a los gobiernos una capacidad de respuesta eficiente y transparentemente para diseñar y ejecutar optimas políticas públicas, así como planes integrales de desarrollo. En este curso se pretende ofrecer a los alumnos las herramientas para que cada uno de ellos, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias, sea capaz de implementar un proyecto SIG sobre el Catastro, entendiendo que el Sistema de Catastro está conformado por los siguientes elementos: Personas, datos, procesos, hardware, software.

¿Cuál es la metodología del curso?

El curso se dictará completamente en línea. Durante 8 semanas se desarrollará cada semana un módulo, el cual se abrirá con lecturas y actividades en línea coordinadas con la supervisión académica de tutores especializados, quienes asistirán, orientarán y retroalimentaran a los participantes mientras éstos asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje. Como parte del curso el participante elaborará un trabajo final cuyo objetivo es que el participante valide el conocimiento a través de la puesta en práctica de los conocimientos, generalmente resultando en la creación de una propuesta de proyecto, mismo que abordará temas directamente relacionados con su entorno laboral. El participante dispondrá de herramientas del Aula Virtual, incluyendo chats, foros interactivos y correos electrónicos.

Certificación: Solamente aquellos participantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de forma, fondo y procedimiento del curso, de acuerdo a la evaluación final del tutor, recibirán un Certificado Digital de la OEA (SAP) acreditando su aprobación. **El envío del original tendrá un costo de US\$20.00 dólares.**

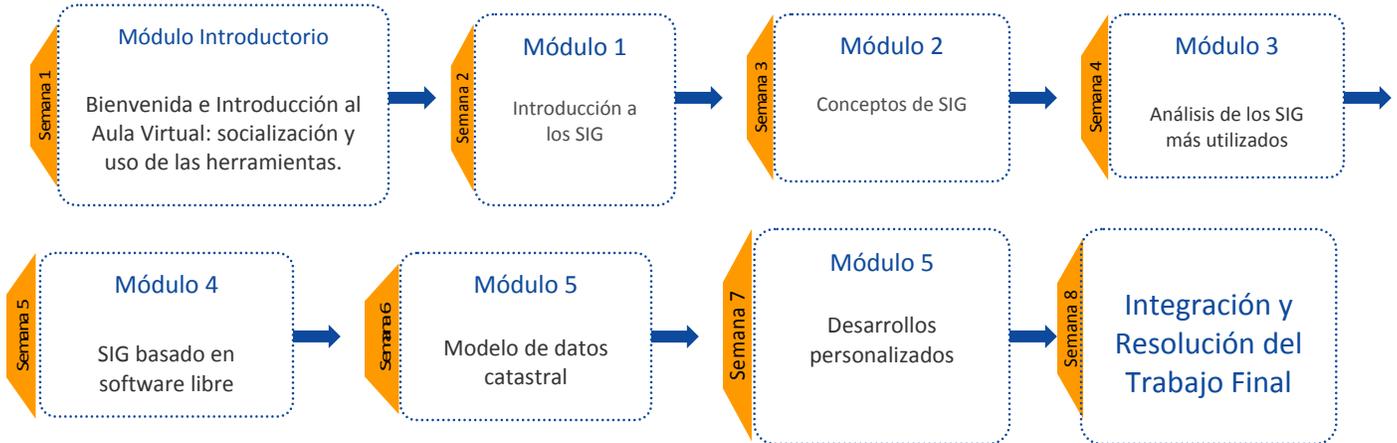
¿Cuáles son los resultados esperados?

Al finalizar el curso los participantes adquirirán las herramientas para que cada uno de ellos, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias, sea capaz de lograr la definición de un Plan del Proyecto de SIG sobre el catastro. Conscientes de la importancia que representa para los gobiernos, especialmente para los gobiernos locales que en muchos países sus respectivos marcos legales les adjudicaron la potestad sobre el tema catastral, la OEA ofrece este curso conformado por seis módulos temáticos en los que paso a paso se ofrecen los elementos para que al final del curso, cada alumno esté en posibilidad de diseñar su propio proyecto.



CONVOCATORIA CURSO EN LINEA

¿Qué vamos a aprender?



¿A quién está dirigido?

- Gerentes públicos y personas con puestos directivos en la administración pública.
- Profesionales, académicos y estudiantes en áreas relacionadas con la materia del curso, que estén interesados en utilizarla como herramienta para mejorar la gestión de gobierno.

¿Qué debo hacer para participar?

1. Inscribise: Haga clic [aquí](#).
2. Espere los resultados de la inscripción el día **9 de Sept.** Si resulta beneficiado, recibirá las instrucciones de pago. Recuerde que si es aceptado, automáticamente es beneficiario de la *beca parcial que le entrega la OEA* por US\$200 sobre el valor total del Curso de US\$ 350, dejando el costo final por participante de US\$ 150.
3. Cancele el valor del curso entre **9 de Sept. y el 25 de Sept.** equivalente a US\$150 después de la *Beca-OEA*.
4. Espere que su tutor se comunique con usted el mismo día que inicia el curso el **3 de Octubre**.

Recuerde, estas son las fechas y etapas que debe tener en cuenta para su participación en el curso:



Para mayor información, consultas o inquietudes escribanos a formacion@oas.org.